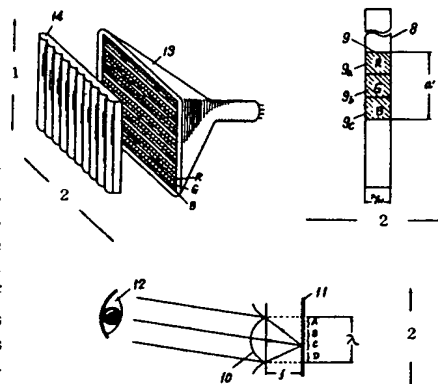


**(54) STEREOSCOPIC IMAGE DISPLAY DEVICE**

(11) 55-129337 (A) (43) 7.10.1980 (19) JP  
 (21) Appl. No. 54-37275 (22) 28.3.1979  
 (71) MATSUSHITA DENKI SANGYO K.K. (72) SHINICHI TANAKA(3)  
 (51) Int. Cl.<sup>3</sup> G03B35/00, H04N9/58

**PURPOSE:** To achieve the higher performance of the stereoscopic image display device by making the size of the picture elements of the original image in the same direction as the lengthwise direction of the circular cylindrical lenses of a reticular longer than the direction perpendicular to this and arraying plural primary colors in the lengthwise direction of the picture elements.

**CONSTITUTION:** If the pitch of the configuration of the circular cylindrical lenses of the reticular plate is let  $\lambda$  and the number of channels N, then the transverse width of a picture element 9 is the same  $\lambda/4$  as that of striped images 8. The picture element 9 is trisected in three primary colors R, G, B in the longitudinal direction. At this time, the length  $a'$  of the picture element 9 is made larger than the transverse width and the size of the picture element of one color is made approximately the same longitudinally and cross. The original color is constituted by 4 channels and if one stripe image C is viewed by the eye 12, the transverse width of the picture elements becomes  $\lambda$  and is magnified 4 times. According to this, the longitudinal size of the picture elements is magnified to less than about  $\lambda$  within the range where the effect upon the resolution of the reconstructed image of the original picture is small and the respective elements of the three primary colors are arrayed longitudinally. In this way, the performance of the stereoscopic image display device is improved and this is also applied to color televisions.



1: longitudinal direction, 2: transvers direction

**(54) PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITION**

(11) 55-129339 (A) (43) 7.10.1980 (19) JP  
 (21) Appl. No. 54-37640 (22) 29.3.1979  
 (71) KOGYO GJUTSUIN (JAPAN) (72) FUSAE NAKANISHI(3)  
 (51) Int. Cl.<sup>3</sup> G03C1/68, G03C5/00

**PURPOSE:** To obtain the title composition having superior operability, resolving power, etc. and capable of easily setting its photosensitive wavelength zone by dispersing fine crystals of a solid-phase-photopolymerizable olefin compound in a synthetic resin matrix.

**CONSTITUTION:** A solid-phase-photopolymerizable olefin compound such as p-formylcinnamic acid or m-phenylenediacrylic acid is dispersed in a synthetic resin matrix such as polyolefin, acrylic resin or polyamide resin in a fine crystal state of about 10~100 $\mu$  in particle size to obtain a photosensitive resin composition. A sensitizer such as 1,2-benzanthraquinone or 2-nitrofluorene may be blended into the composition.

**(54) PHOTSENSITIVE COVERING COMPOSITION**

(11) 55-129341 (A) (43) 7.10.1980 (19) JP  
 (21) Appl. No. 54-38092 (22) 29.3.1979  
 (71) DAICEL K.K. (72) KEIJI KUBO(1)  
 (51) Int. Cl.<sup>3</sup> G03C1/71, C08L61/10, G03F7/08, H01L21/302, G03C1/52

**PURPOSE:** To enhance the coating properties of a photosensitive composition prepared by blending an alkali-soluble phenol-formaldehyde resin with a photosensitizer and enhance the coat characteristics of the resulting film by adding a specified resin such as epoxy resin.

**CONSTITUTION:** To a photosensitive composition prepared by mixing a photosensitizer such as 4,4'-diazidophenylamine and an alkali-soluble phenol-formaldehyde resin such as phenol-novolak resin in a ratio of about 1:0.5~6 by wt. is added 5~40wt%, preferably 7~30wt% of one or more kinds of resins selected from epoxy resin preferably having a MW of about 500 or less, butyral resin preferably having a butyral conversion degree of about 60~70mol% and obtained from polyvinyl alcohol having an average polymerization degree of about 250~2,000, acrylic resin, preferably acrylic acid-acrylic acid ester copolymer, and butyl-etherified phenol resin, preferably butyl-etherified resol type phenol resin.

⑨ 日本国特許庁 (JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭55-129341

⑪ Int. Cl.<sup>3</sup>

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 昭和55年(1980)10月7日

G 03 C 1/71

6791-2H

C 08 L 61/10

7455-4J

G 03 F 7/08

1 0 3

7267-2H

H 01 L 21/302

6741-5F

G 03 C 1/52

発明の数 1

審査請求 未請求

(全 5 頁)

⑭ 感光性被覆組成物

① 特 願 昭54-38092

② 出 願 昭54(1979)3月29日

③ 発 明 者 久保圭司

尼崎市次屋字林シ238

④ 発 明 者 石原哲男

伊丹市昆陽字佐藤前22の1

⑤ 出 願 人 ダイセル化学工業株式会社

堺市鉄砲町1番地

⑥ 代 理 人 弁理士 野河信太郎

明 細 書

1. 発明の名称

感光性被覆組成物

2. 特許請求の範囲

1. 感光化剤とアルカリ可溶性フェノールホルムアルデヒド樹脂を含有する感光性組成物において、該組成物中にエポキシ樹脂、ブタール樹脂、アクリル樹脂及びブチルエーテル化フェノール樹脂より選ばれ、少なくとも1種の添加剤を5〜40重量%含有することを特徴とする感光性被覆組成物。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、感光化剤、アルカリ可溶性フェノールホルムアルデヒド樹脂及び添加剤からなる改良された施工性及び良好な被膜を与える感光性被覆組成物に関するものである。

従来アルミニウム、亜鉛の如き金属板の支持体上に感光性材料として、アジド化合物、0-キノ

ンジアジド化合物又は有機溶剤可溶性ジアゾ化合物と、且つアルカリ水溶液で現像可能なフェノールホルムアルデヒド樹脂を含む溶液を塗布し、印刷版として使用する方法は公知である。また、上記の感光性被覆組成物は、金属メッキ用、あるいは金属、セラミック、ガラス等のエッチング用のフォトレジストとしても利用される。

しかしながら、フェノールホルムアルデヒド樹脂を使用したこの種の公知の被覆組成物は、フェノールホルムアルデヒド樹脂の重合度が低いために施工に当って溶液粘度を上げることができず施工性に劣り、また、この被覆組成物より得られる被覆膜は、被覆が脆いこと、引抜き傷が付き易いこと、耐摩耗性に劣ること、塗質の金属板に対する接着性が悪いことと接着性が悪いと、例えばフォトレジストのエッチングの際にアンダーカットのレリーフしか得られない等の不都合が生じる)、ピンホールが多い等の被覆特性上の欠点を有していた。

これを改良する目的で、ポリ酢酸ビニル、エチ

(1)

(2)

ルセルローズ、アセチルブチルセルローズの親油性高分子化合物やフタル酸エステル類、グリコールエステル類、リン酸エステル類、脂肪族二塩基酸エステル類等の可塑剤を添加することが行われている。しかし、前記の如き高分子化合物は塗工工程において使用する有機溶剤への溶解性に限度があり、一定量以上加えても溶解せず、また前記可塑剤は現像液に溶解しやすいので多量に用いると、残存させるべき部分までも溶解してしまい、うまく現像することができない。このようなことから、これらの添加剤は、いずれも感光性組成物全量に対して1〜5重量部の範囲でしか用いることができず、上記塗工性や被膜特性上の問題を充分に解決するには至っていない。

本発明の発明者らは上記のような欠点を改善するために鋭意検討の結果、通常の感光化剤とアルカリ可溶性フェノールホルムアルデヒド樹脂を含有する感光性組成物に、エポキシ樹脂、ブタール樹脂、アクリル樹脂及びブチルエーテル化フェノール樹脂（これらは、いずれもフェノールホルム

(3)

可溶）等が挙げられる。その代表的なものを例示すれば下記の通りである。

(1) アジド化合物：4, 4'-ジアジドジフェニルアミン、3, 3'-ジメトキシ-4, 4'-ジアジドジフェニル、4, 4'-ジアジドスチルベン、4, 4'-ジアジドカルボン、2, 6-ジ-（4'-アジドペンザル）シクロヘキサノン、1-アジドピレン

(2) 0-キノンジアジド化合物：1, 2-ベンゾキノンジアジド(2)-4-スルホン酸または1, 2-ナフトキノンジアジド(2)-5-スルホン酸とフェノールホルムアルデヒド樹脂とのエステル、1, 2-ベンゾキノンジアジド(2)-スルホン酸または1, 2-ナフトキノンジアジド(2)-5-スルホン酸とポリヒドロキシフェノールまたは2, 3, 4-トリヒドロキシベンゾフェノンとのエステル

(3) ジアゾ化合物：p-ジアゾジフェニルアミンとホルムアルデヒドの縮合生成物とp-トル

(5)

特開昭55-129341(2)

アルデヒド樹脂との相溶性が優れている)から選ばれる少なくとも1種を添加した組成物とすることにより、塗工性が改良され、また、この組成物より得られる被覆層の被膜は柔軟性に富み、引張強度との相溶性に優れ、引張強度との相溶性に優れ、耐摩耗性が改良され、ピンホールが非常に少なく均一で美麗である等の優れた被膜特性を示すことを見出し本発明に到達した。

即ち、本発明は、感光化剤とアルカリ可溶性フェノールホルムアルデヒド樹脂を含む感光性組成物に、エポキシ樹脂、ブタール樹脂、アクリル樹脂及びブチルエーテル化フェノール樹脂より選ばれる少なくとも1種の添加剤を5〜40重量部添加してなる感光性被覆組成物を提供するものである。

本発明の感光性組成物に用いることのできる感光化剤としては、ジャロミラ・コサール(Jaromir Kosar)著「Light-Sensitive Systems」(John Wiley & Sons Incorporation)の第321〜352頁に記載されているアジド化合物、0-キノンジアジド化合物及びジアゾ化合物(有機溶剤

(4)

エンスルホン酸または2-ヒドロキシ-4-メトキシベンゾフェノン-5-スルホン酸との反応生成物

本発明の感光性組成物に用いることのできるアルカリ可溶性フェノールホルムアルデヒド樹脂としては、通常のフェノールノボラック樹脂、メクレゾールノボラック樹脂、カシユー酸性ノボラック樹脂、アルキルフェノールとフェノール等との共縮合ノボラック樹脂等が適当である。これらは、単独で用いるのみでなく、混合してもさしつかえない。

本発明の感光性組成物中の感光化剤とアルカリ可溶性フェノールホルムアルデヒド樹脂との混合割合は、感光化剤により異なるが、一般的には、重量比が2:1〜1:6の範囲が好ましい。

本発明の組成物に添加される添加剤としては、エポキシ樹脂、ブタール樹脂、アクリル樹脂及びブチルエーテル化フェノール樹脂がある。

エポキシ樹脂としては通常の市販のものが使用

(6)

できるが、常態で液状で、分子量500以下のものが好ましい。例えば、常態で液状で、分子量500以下のビスフェノールA、ビスフェノールF、ハロゲン化ビスフェノールA又はレゾルシンとエピクロルヒドリンとの共重合体が好ましいものとして挙げることができる。市販の商品としては、例えばシエル化学社製のエピコート815、エピコート827、エピコート828等が好ましいものとして挙げられる。

ブチラール樹脂としては、市販の有機溶剤可溶性のブチラール樹脂なら全てのものが使用可能であるが、好ましくは、平均重合度250~2000のポリビニルアルコールから構られるブチラール化度60~70セルものものがよい。

アクリル樹脂としては、アクリル酸とアクリル酸エステル、例えばアクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸ブチル、アクリル酸2-エチルヘキシル等との共重合体が好ましい。これらの共重合体は、アクリル酸含量が多くなるとアルカリ水溶液に対する溶解性が増大し、このよう

(7)

や用途によつて染料や増感剤等を含有することができる。

本発明の感光性被覆組成物は、前記した混合成分を有機溶剤に加え、溶解させることによつて調製することができる。この場合の有機溶剤としては、トルエン、キシレン、ベンゼン、酢酸エチル、酢酸ブチル、セロソルブアセテート、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、セロソルブ(メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、フェニルセロソルブ等)、ジオキサン等が単独あるいは混合溶媒として用いられる。

このようにして調製した塗布液は、従来公知の方法、例えばロール塗布法、エアナイフ塗布法、浸漬法、回転塗布法、スプレー塗布法等によつて種々の基板上に塗布し、乾燥せしめることによつて感光性被覆層を形成せしめる。かかる基板としては、アルミニウム、亜鉛、銅等のような金属板、ポリエチレンテレフタレート、ポリステレン、ポリプロピレン等のようなプラスチックフィルム、上記のような金属がラミネートもしくは蒸着され

(8)

アクリル樹脂の添加によつて組成物全体の溶解性が増加するので現像性に悪影響を及ぼすので、アクリル酸含量が数重量%以下のものが好適に使用される。また、適度の平均重合度のものが用いられ、30°Cにおける粘度(パルク)が3000~6000 cPのもの好ましい。

ブチルエーテル化フェノール樹脂としては、熱反応型のフェノールホルムアルデヒド樹脂(レゾール型フェノール樹脂)をブチルエーテル化したものが用いられる。

本発明において、感光性組成物に添加するエポキシ樹脂、ブチラール樹脂、アクリル樹脂及びブチルエーテル化フェノール樹脂より選ばれる少なくとも1種の量は、感光材料の現像性に悪影響を与えない程度にとどめるべきであり、一般的には感光性組成物に対して5~40重量%、好ましくは7~30重量%の範囲である。5重量%より少ないと添加の効果が得られず、40重量%より多く添加するとアルカリ現像性が損なわれる。

又、本発明の組成物は、その成分化合物の種類

(9)

た数もしくはプラスチックフィルム等が含まれる。

本発明の感光性被覆から得られる感光材料はカーボンアーク灯、水銀灯、キセノンランプ、タンタラムランプ等の光源により露光されたのち、現像液で処理する。現像液としては、基本的には従来から公知のアルカリ溶液が使用される。例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ケイ酸ナトリウム、第3リン酸ナトリウム等のアルカリ類やエタノールアミンのような塩基性溶剤等の水溶液がある。これらのアルカリ水溶液は単独であるいは混合して用いることができる。更に必要な場合には、これらのアルカリ水溶液にある種の有機溶剤、例えばベンジルアルコール、イソプロピルアルコール、メチルセロソルブ等を加えることも可能である。又、特に必要ならば現像液の中に界面活性剤を添加することもできる。

次に実施例を挙げて本発明を例証する。

実施例1 及び 比較例1

感光化剤(1, 2-ナフトキノンジアジド(2)-5

(10)

ーホルホルクロライドとアル 5 g  
カリ可溶性フェノールノボラツ  
ク樹脂との混合物)

アルカリ可溶性クレゾールノボラツク樹脂 10 g  
エポキシ樹脂 (エポコート 828、シエル 3 g  
化学社製)

溶剤 (メチルエチルケトン/メチルセロソ  
ルブアセテート = 2/1) 100 g

なおエポコート 828 は市販のビスフェノール  
系エポキシ樹脂で下記の性状を有する。

融点 (デュランス水銀法) : 常温で液状

色 (ガーボナー、25°C) : 2 max

粘度 (ボイズ、25°C) : 110~150

エポキサイド当量 : 182~194

分子量 : 約 355

02

接着性、引抜き傷の付き難さ、耐摩耗性、皮膜の  
柔軟性、ピンホール発生率等で優れていた。

#### 実施例 2

感光化剤 (1, 2-ナフトキノンジアシド (2)-5  
ーホルホルクロライドとポリ  
ヒドロキシフェノールとの混合物) 7 g

アルカリ可溶性フェノールノボラツク樹脂 7 g

ブチルエーテル化フェノール樹脂 4 g

溶剤 (メチルエチルケトン/メチルセロソ  
ルブアセテート = 2/1) 100 g

実施例 1 と同様な操作により同様の良い結果が得  
られた。

#### 実施例 3

2, 6-ジ- (4-アジドベンザル) 2 g  
ーシクロヘキサノン

アルカリ可溶性フェノールノボラツク樹脂 10 g

03

特開昭 55-129341 (4)

上記組成物溶液をフィルターでろ過したものを  
スピナー塗布機でシリコンウエハー上に塗布し、  
70°C で 10 分間空気乾燥器中で乾燥した。乾燥  
後、超高圧水銀灯を光源としてネガマスクを通し  
て 1 分間露光した。光の照射されたウエハーは、  
多量 3 リン酸ナトリウム液 (液温 25°C) に浸漬  
し現像した。その結果、優れた解像力を有するパ  
ターンが得られた。これをフッ化アンモニウムで  
フォトリソストをエッチングしたが、接着性がよ  
いためアンダーカットがほとんどない解像力の  
優れたレリーフを得た。

また、ひび割れやピンホールもなく引抜き傷が  
付き難く、耐摩耗性に優れ、皮膜の柔軟性も認め  
られた。

次に実施例 1 における本発明組成物の比較例と  
して実施例 1 のエポキシ樹脂を使用せず、その他  
は全て上記実施例 1 と同様に配合して得た従来の  
組成物をシリコンウエハー上に塗布し、露光、現  
像及びエッチングを行つた。得られたレリーフを  
比較したところ、実施例 1 のレジスト材料の方が

04

ブチラール樹脂 (エスレックス BLS、 2 g  
積水化学製)

溶剤 (エチルセロソルブアセテート/トルエン/  
酢酸ブチル = 2/1/1) 100 g

上記組成物溶液をフィルターでろ過したものを  
ロール塗布機で、予め表面処理された写真凸版用  
亜鉛板に塗布し、80°C で 20 分間空気乾燥器中  
で乾燥した。乾燥後、超高圧水銀灯を光源として、  
ポジフィルムを通して 2 分間密着露光した。これ  
を水酸化ナトリウム 0.3 多を含む現像液に浸漬し、  
25°C で現像し、水洗すると、解像力の優れたレ  
ジスト像が得られた。引続いて、10 多硝酸でエ  
ッチングを行つたところ、アンダーカットはなく、  
接着性の良好なことが判明した。ブチラール樹脂  
を添加した組成物は、未添加のものに比べ、得ら  
れる感光性被膜及び現像、エッチング後のレジス  
トの接着性及び強度、引抜き傷の付き難さ、皮膜  
の柔軟性、耐摩耗性等が向上していた。

05

## 実施例 4

光増感剤 (実施例 1 と同じ) 5 g

アルカリ可溶性フェノールノボラック樹脂 10 g

アクリル樹脂 (アロン 5 P-9001, 1.5 g  
東亜合成製)

溶剤 (メチルエチルケトン/メチルセロソ

ルブアセテート = 2/1) 100 g

実施例 1 と同様の操作により同様の良い結果を得た。

## 実施例 5

赤色有機着色染料を含有するアルコール可溶性ポリアミドからなる有機被覆層を乾燥した厚さ 20  $\mu$  になるように、二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムに被覆した。実施例 1 の感光性組成物を得られたポリアミド層に乾燥した厚さ 3  $\mu$  に被覆して感光性フォトリソレジスト層を形成させた。この感光性シート材料を、3 KW 超高圧水銀灯の光源から 1.0 m の距離で、ネガフィルムを通して

59

上記組成物を用いて実施例 3 と同様の操作を行い、良好な結果が得られた。

## 実施例 7

光増感剤 (実施例 1 に同じ) 5 g

アルカリ可溶性フェノールノボラック樹脂 10 g

ブチルエーテル化フェノール樹脂 (実施例 2 に同じ) 3 g

アクリル樹脂 (実施例 4 に同じ) 1 g

ブチラール樹脂 (実施例 3 に同じ) 0.5 g

溶 剤 100 g

(メチルエチルケトン/メチルセロソルブアセテート/酢酸ブチル = 4/2/1)

上記組成物を用いて実施例 1 と同様の操作を行い、良好な結果を得た。

代理人 弁護士 野 河 信 太 郎

50 秒間露光し、5 % メタケイ酸ナトリウム水溶液で 2 分間現像し、現像後水洗した。

次に、トルエンスルホン酸ナトリウム、アルコール及び水からなる処理液を浸させた脱脂綿で現像したシート材料を軽くこすることにより、ポリアミド層をフォトリソレジスト層の開放画像領域でポリエステルフィルムからきれいに除去できた。得られた画像材料は写真製版のための製版用マスターとして有用であつた。

## 実施例 6

2,6 - ジ - (4' - アジドベンザル) -

4 - メチルシクロヘキサノン 2 g

アルカリ可溶性クレゾールノボラック樹脂 10 g

エポキシ樹脂 (実施例 1 に同じ) 0.5 g

ブチラール樹脂  
(エスレック ス B M 8, 機水化学製) 1 g

溶 剤

(エチルセロソルブアセテート/トルエン/  
酢酸ブチル = 2/1/1) 100 g

59